PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-049272

(43) Date of publication of application: 18.02.2000

(51)Int.CI.

H01L 23/50

H01L 21/52

H01L 21/60

(21)Application number: 10-216837

(71)Applicant: HITACHI LTD

AKITA DENSHI KK

(22)Date of filing:

31.07.1998

(72)Inventor: KIKUCHI TAKAYA

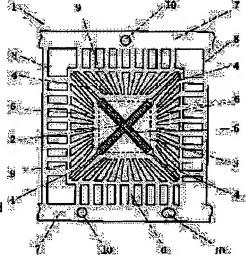
MATSUI HITOSHI

(54) LEAD FRAME, MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE EMPLOYING IT AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a technology for mounting a semiconductor chip well while enhancing reflow crack resistance.

SOLUTION: In the lead frame of a resin sealed semiconductor device and manufacturing technology thereof, a die pad 2 for mounting a semiconductor chip 11, in which specified circuits are fabricated, is formed substantially in cross. An insulating adhesive tape 5 is applied to the semiconductor chip mounting face of the die pad 2 so that the semiconductor chip 11 is mounted on the die pad 2 through the adhesive tape 5. Since adhesion area between the semiconductor chip 11 and sealing resin can be increased while ensuring adhesion area between the semiconductor chip 11 and the die pad 2, reflow crack resistance of semiconductor device can be enhanced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-49272 (P2000-49272A)

(43)公開日 平成12年2月18日(2000.2.18)

(51) Int.CL7		識別記号	FΙ			テーマコート・(参考)
H01L	23/50		H01L	23/50	U	5 F 0 4 4
	21/52			21/52	A	5 F 0 4 7
	21/60	301		21/60	301B	5 F O 6 7
					301M	

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 11 頁)

(21)出願番号	特願平10-216837	(71)出頃人	
			株式会社日立製作所
(22)出顧日	平成10年7月31日(1998.7.31)	A. 8	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地
		(71)出願人	000100997
			アキタ電子株式会社
			秋田県南秋田郡天王町天王字長招64
		(72)発明者	菊地 孝哉
		(10/)09/41	秋田県南秋田郡天王町天王字長昭64 アキ
			夕電子株式会社内
	•		
		(74)代理人	100068504
			弁理士 小川 勝男
	•		

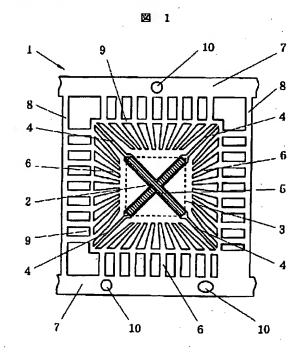
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 リードフレーム及びそれを用いた半導体装置の製造方法並びに半導体装置

(57)【要約】

【課題】リフロークラック耐性を向上させることができ、かつ半導体チップを良好に搭載することができる技術を提供する。

【解決手段】樹脂封止型半導体装置のリードフレーム及びその製造技術において、所定の回路が形成された半導体チップ11を搭載するダイパッド2が略十字形状に形成され、かつ前記ダイパッド2の半導体チップ搭載面に絶縁性の接着テープ5を有しており、前記半導体チップ11が絶縁性の接着テープ5を介してダイパッド2に搭載されるように構成したことにより、前記半導体チップ11と前記ダイパッド2との接着面積を確保しつつ、前記半導体チップ11と封止樹脂との接着面積を大きくすることができ、半導体装置のリフロークラック耐性を向上することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 略四角形の板状で一面に所定の回路が形 成された半導体チップと、前記半導体チップを搭載する ダイパッドと、前記ダイパッドを支持する複数の支持リ ードと、前記ダイパッドの近傍から外方に向かって延在 し、前記半導体チップの一面に設けられた電極パッドと 電気的に接続される複数のリードと、前記半導体チップ 及び前記リードの電極パッドとの接続部一帯を封止する パッケージとを有する半導体装置において、前記ダイパ 体チップ搭載面に絶縁性の接着テープを有しており、前 記半導体チップが前記接着テープを介してダイパットに 搭載されることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記略十字形状に形成されたダイパッド が、前記支持リードの幅より幅広に構成したことを特徴 とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 前記略十字状に形成されたダイパッド が、前記半導体チップの略対角線上に配置され、前記半 導体チップを搭載していることを特徴とする請求項1記 載の半導体装置。

【請求項4】 前記半導体チップが、その一面を前記ダ イパッドの搭載面に搭載され、かつ該半導体チップの略 対角線上を固定するように配置されていることを特徴と する請求項1記載の半導体装置。

【請求項5】 前記ダイパッドが、その搭載面から他面 に開口する開口部を有していることを特徴とする請求項 1 記載の半導体装置。

【請求項6】 所定の回路が形成された半導体チップを 搭載するダイパッドと、前記ダイパッドを支持する支持 リードと、前記ダイパッドの近傍に設けられ前記半導体 30 チップと電気的に接続される複数のリードとを有するリ ードフレームにおいて、前記ダイパッドが十字形状に形 成され、かつ前記ダイパッドの搭載面に半導体チップを 固定するための接着テープが設けられていることを特徴 とするリードフレーム。

【請求項7】 前記十字形状に形成されたダイパッド が、前記支持リードの幅より幅広に形成されていること を特徴とする請求項6記載のリードフレーム。

【請求項8】 前記十字形状に形成されたダイパッド が、その搭載面から他面に開口する開口部を有すること 40 てしまう。 を特徴とする請求項6記載のリードフレーム。

【請求項9】 略四角形の板状で一面に所定の回路が形 成された半導体チップを搭載する略十字形状のダイパッ ドと、前記ダイパッドを支持する支持リードと、前記ダ イパッドに搭載される半導体チップと電気的に接続され る複数のリードと、前記ダイパッドの搭載面に半導体チ ップを固定する絶縁性の接着テープとからなるリードフ レームを準備する工程と、前記略十字形状のダイパッド に半導体チップを、該半導体チップの略対角線上に配置 するように位置決めし、前記ダイパッドの搭載面に設け 50

られた絶縁性の接着テープにより搭載する工程と、前記 半導体チップの一面に設けられた電極パッドと前記リー ドとを電気的に接続する工程と、前記半導体チップの電 極パッドと前記リードとを電気的に接続したリードフレ ームを上下で一対となるモールド金型により型締めし、 前記モールド金型に溶融された樹脂を注入することによ り前記リードフレームにパッケージを形成する工程とを 有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項10】 前記半導体チップが、前記電極パッド ッドは略十字状に形成され、かつ前記ダイパッドの半導 10 を露出するように前記一面を前記ダイパッドに搭載され ることを特徴とする請求項9記載の半導体装置の製造方

> 【請求項11】 前記リードフレームのダイパッドが、 前記モールド金型へ樹脂を注入する際に、前記リードフ レームを型締めしたモールド金型の上側の空間と下側の 空間とを略同一にするようにダウンセット加工されてい ることを特徴とする請求項9記載の半導体装置の製造方 法。

【発明の詳細な説明】

20 [0001]

> 【発明の属する技術分野】本発明は、リードフレーム及 びそれを用いた半導体装置の製造方法並びに半導体装 置、特に半導体装置のリフロークラック耐性の向上に適 用して有効な技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の表面実装型の樹脂封止型半導体装 置では、表面実装後の耐湿性の低下が重要な問題となっ ている。

【0003】すなわち、前記樹脂封止型半導体装置が大 気中等から水分を吸湿してしまうと、リフロー半田付け 時に加えられる熱により半導体装置のパッケージ内の接 合界面、例えば半導体チップを搭載するダイパッドの裏 面と前記パッケージを形成する樹脂との界面が剝離して しまい、その剥離面に水蒸気圧が作用することによりパ ッケージが膨張し、パッケージクラックを引き起こして しまう。このようなパッケージクラックによって、水分 や不純物がパッケージ内に侵入してしまい半導体チップ を腐食させたり、前記クラックがパッケージ表面まで達 したり、パッケージが膨れて変形すると外観不良となっ

【0004】このような前記ダイパッドの裏面とモール ド樹脂との界面の剥離を対策する技術としては、例えば 前記ダイパッドに十文字のスリットを形成する技術があ る。前記ダイパッドに十文字のスリットを形成すること により、スリット部分では前記ダイパッドに搭載される 半導体チップと封止樹脂とが接着され、接合界面が剥離 しにくい構造となる。このダイパッドに十文字のスリッ トを設ける技術としては例えば1993年5月31日、 日経BP社発行の「VLS I パッケージング技術

(上)」の206頁乃至216頁に記載されている。

【0005】しかし、近年は半導体チップの大チップ化 及びパッケージの薄型化が進んできており、パッケージ に占める半導体チップの面積が増大する傾向にある。そ のため前述したようにダイパッドに十文字のスリットを 用いて、前記半導体チップを搭載するダイパッドと封止 樹脂との密着性を向上させることだけでは、リフロー半 田付け時のパッケージクラックを良好に対策できなくな る恐れがあった。

【0006】また前記リフロー半田付け時のパッケージ クラックの対策を目的とした技術として、ダイパッドの 10 るであろう。 外形寸法をその上に搭載する半導体チップの外形寸法よ りも小さく構成した技術としては、例えば特開平6-2 16303号公報がある。その概要としては、半導体チ ップの外形寸法よりも小さい外形寸法に構成したダイパ ッドに塗布された接着剤により半導体チップを搭載する ように構成することにより、前記半導体チップと封止樹 脂との接着面積を大きくするものである。また前記半導 体チップとダイパッドとの接着強度を向上するために、 前記ダイパッドの支持リードに該支持リードより幾分広 い小パッドを形成し、樹脂封止の際の溶融された樹脂の 20 流動によるダイパッドの変動を防止する旨の記載もあ

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し たように半導体チップより小さく構成されたダイパッド により半導体チップを搭載するように構成した場合にお いては、前記支持リードに設けられた小パッドにより前 記ダイパッドと半導体チップとの接着面積を補強してい るが、前記ダイパッドへの半導体チップ搭載後の樹脂封 止工程においてパッケージを形成する際、溶融された封 30 る。 止樹脂の流動により半導体チップ或いは半導体チップを 搭載するダイパッドを変動させてしまう恐れがある。こ のような半導体チップ及びダイパッドの変動によって は、半導体チップとダイパッドとの剥離、或いはダイパ ッドの変動に伴うワイヤの露出の不良も発生してしま う。

【0008】また前記半導体チップと前記ダイパッドと の接着面積が少ないため、前記半導体チップの電極パッ ドとリードとのワイヤボンディング処理時において、リ がらワイヤを半導体チップに圧着する際に、前記超音波 振動が良好に引加されない恐れもある。それにより、半 導体チップの電極パッドとリードとを結線したワイヤが 良好に接着されず、ワイヤ剥がれ等の不良を引き起こし てしまう。

【0009】さらに前記半導体チップを前記ダイパッド に搭載する際に小さいパッドに接着剤を塗布しているた め、ディスペンサ等による塗布位置にもある程度高い精 度が要求され、途布された接着剤により半導体チップを 接着する際に前記ダイパッドから接着剤が漏れてしまう 50 れた電極パッドと前記リードとを電気的に接続する工程

恐れもある。

【0010】そこで、本発明の目的は、リフロークラッ ク耐性を向上させることができ、かつ半導体チップを良 好に搭載することができる技術を提供することである。

4

【0011】また、本発明の他の目的は、半導体チップ をフェイスダウンボンディングによりダイパッドに搭載 可能な技術を提供することである。

【0012】本発明の前記ならびにその他の目的と新規 な特徴は、本明細書の記述及び添付図面から明らかにな

[0013]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下 記の通りである。

【0014】すなわち、略四角形の板状で一面に所定の 回路が形成された半導体チップと、前記半導体チップを 搭載するダイパッドと、前記ダイパッドを支持する複数 の支持リードと、前記ダイパッドの近傍から外方に向か って延在し、前記半導体チップの一面に設けられた電極 パッドと電気的に接続された複数のリードと、前記半導 体チップ及び前記リードの電極パッドとの接続部一帯を 封止するパッケージとを有する半導体装置及びそれに用 いられるリードフレームにおいて、前記ダイパッドは略 十字状に形成され、かつ前記ダイパッドの半導体チップ の搭載面に絶縁性の接着テープを有しており、前記半導 体チップが前記接着テープを介してダイパットに搭載さ れるものである。

【0015】前記略十字形状に形成されたダイパッド が、前記支持リードの幅より幅広に構成したものであ

【0016】前記略十字状のダイパッドが、前記半導体 チップの略対角線上に配置され、前記半導体チップを搭 載しているものである。

【0017】前記半導体チップが、その一面を前記ダイ パッドの搭載面に搭載され、かつ該半導体チップの略対 角線上を固定するように配置されるものである。

【0018】前記ダイパッドが、その搭載面から他面に 開口する開口部を有しているものである。

【0019】また半導体装置の製造方法において、略四 ードフレームを保持した状態で、超音波振動を引加しな 40 角形の板状で一面に所定の回路が形成された半導体チッ プを搭載する略十字形状のダイパッドと、前記ダイパッ ドを支持する支持リードと、前記ダイパッドに搭載され る半導体チップと電気的に接続される複数のリードと、 前記ダイパッドの一面に半導体チップを搭載する絶縁性 の接着テープとからなるリードフレームを準備する工程 と、前記略十字形状のダイパッドに半導体チップを、該 半導体チップの略対角線上に配置するように位置決め し、前記ダイパッドの搭載面に設けられた接着テープに より搭載する工程と、前記半導体チップの一面に設けら

と、前記半導体チップの電極パッドと前記リードとを電 気的に接続したリードフレームを上下で一対となるモー ルド金型により型締めし、前記モールド金型に溶融され た樹脂を注入することにより前記リードフレームにパッ ケージを形成する工程とを有するものである。

【0020】前記半導体装置の製造方法において、前記 半導体チップが、前記電極パッドを露出するように前記 一面をフェイスダウンにより前記ダイパッドに搭載す る。

【0021】前記半導体装置の製造方法において、前記 10 リードフレームのダイパッドが、前記モールド金型へ樹 脂を注入する際に、前記リードフレームを型締めしたモ ールド金型の上側の空間と下側の空間とを略同一にする ようにダウンセット加工されている。

【0022】上述した手段によれば、略四角形の板状で 一面に所定の回路が形成された半導体チップと、前記半 導体チップを搭載するダイパッドと、前記ダイパッドを 支持する複数の支持リードと、前記ダイパッドの近傍か ら外方に向かって延在し、前記半導体チップの一面に設 けられた電極パッドと電気的に接続された複数のリード 20 と、前記半導体チップ及び前記リードの電極パッドとの 接続部一帯を封止するパッケージとを有する半導体装置 及びそれに用いられるリードフレームにおいて、前記ダ イパッドは略十字状に形成され、かつ前記ダイパッドの 半導体チップの搭載面に絶縁性の接着テープを有してお り、前記半導体チップが絶縁性の前記接着テープを介し てダイパットに搭載されるように構成したことにより、 前記半導体チップと前記ダイパッドとの接着面積を確保 しつつ、前記半導体チップと封止樹脂との接着面積を大 きくすることができ、半導体装置のリフロークラック耐 30 性を向上できる。

【0023】また前記十字形状に形成されたダイパッドが、前記支持リードの幅より幅広に構成し、前記半導体チップの略対角線上に配置され、前記半導体チップを搭載するように構成したことにより、前記半導体チップはその略対角線上を前記ダイパッドにより固定されるため、前記半導体チップをダイパッドに良好に搭載することができる。

【0024】前記半導体チップが、その一面を前記ダイパッドの搭載面にフェイスダウンで搭載され、かつ前記 40 半導体チップの略対角線上を固定するように配置されることにより、前記半導体チップの電極パッドとリードとのワイヤボンディングの際に、前記リードフレームを良好に保持することができ、超音波振動の引加が良好に行われるため、前記電極パッドとリードとの接続強度を向上できる。

【0025】前記ダイパッドが、その半導体チップ搭載 面から他面に開口する開口部を設けるように構成したこ とにより、半導体チップと封止樹脂との接着面積をさら に大きくし、接着強度を向上することができる。 【0026】また半導体装置の製造方法において、略四 角形の板状で一面に所定の回路が形成された半導体チップを搭載する略十字形状のダイパッドと、前記ダイパッドに搭載される半導体チップと電気的に接続される複数のリードと、

6

前記ダイパッドの搭載面に半導体チップを固定する絶縁 性の接着テープとからなるリードフレームを準備する工 程と、前記略十字形状のダイパッドに半導体チップを、

該半導体チップの略対角線上に配置するように位置決め し、前記ダイパッドの搭載面に設けられた接着テープに より搭載する工程と、前記半導体チップの一面に設けら れた電極パッドと前記リードとを電気的に接続する工程 と、前記半導体チップの電極パッドと前記リードとを電 気的に接続したリードフレームを上下で一対となるモー ルド金型により型締めし、前記モールド金型に溶融され た樹脂を注入することにより前記リードフレームにパッ ケージを形成する工程とを有するように構成したことに

搭載することができ、かつ前記半導体チップとダイバッドとの接着強度を確保しつつ、半導体チップと封止樹脂との接着面積を大きくすることができる。

より、前記リードフレームに前記半導体チップを容易に

【0027】また前記半導体チップが、前記電極パッドを露出するように前記一面をフェイスダウンにより前記ダイパッドに搭載することにより、前記半導体チップの電極パッドとリードとのワイヤボンディングの際に、前記半導体チップ上に配置されるダイパッドにより半導体チップを良好に保持することができるため、半導体チップへ超音波振動の引加を良好に行うことができる。

【0028】さらに前記リードフレームのダイバッドが、前記モールド金型へ樹脂を注入する際に前記リードフレームを型締めしたモールド金型の上側の空間と下側の空間とを略同一にするようにダウンセット加工することにより、前記モールド金型へ注入される封止樹脂の流動を前記モールド金型の上下の空間で略均一化することができ、良好にバッケージを形成することができる。【0029】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 図面を用いて説明する。

【0030】尚、本発明の実施形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。

【0031】(実施形態1)本実施形態ではQFP(Quad Flat Package)の半導体装置に適用した場合について説明する。図1は本発明の一実施形態であるリードフレームにおける単位フレーム構成示す平面図であり、前記単位フレームは所定の方向に複数個、連設されている

【0032】前記リードフレーム1はその中心位置にダイパッド2が配置されており、前記ダイパッド2には所 50 定の回路が形成された半導体チップが搭載される。本実 施形態ではダイパッド2が、例えば略十字形状 (または ×字形状ともいう)に構成されている。そして、前記十 字形状に構成されたダイパッド2には、図1の点線枠の 半導体チップ搭載部位3に示すように、前記四角形の板 状である半導体チップの略対角線上を接着固定される。 また前記十字形状のダイパッド2は前記十字形状の突出 部分がそれぞれ支持リード4に接続されており、前記支 持リード4により前記リードフレーム1に支持されてい る。また、前記ダイパッド2は例えば前記支持リード4 プと前記ダイパッド2との接着強度を確保するように構 成されている。そして前記ダイパッド2の搭載面、つま りは半導体チップを搭載する側の面には前記半導体チッ プをダイパッド2に接着固定するための接着テープ5が 設けられている。前記接着テープ5は前記ダイパッド2 と略同一の形状に構成されており、例えばポリイミド系 樹脂基板の両面に接着剤層を散けたテープ等により半導 体チップを接着固定するように構成されている。また前 記接着テープ5は熱可塑性ポリイミドによるテープを用 いて前記半導体チップを熱圧着することにより搭載する ように構成してもよい。

【0033】そして前記ダイパッド2の周囲には、前記 ダイパッド2に搭載される半導体チップの電極パッドと ワイヤ等により電気的に接続されるリード6の一端であ るインナー部が複数配置されている。前記リード6の他 端であるアウター部は前記リードフレーム1の外枠7成 いは枠部8に接続され、前記複数のリード6はリードフ レーム1に支持されている。また、前記複数のリード6 は枠状に形成されたダムバー9にそれぞれ接続されてい るパッケージを取り囲む程度の大きさで配置されてお り、前記樹脂封止の際に注入される封止樹脂の流出を防 止している。また前記外枠7にはリードフレーム1の搬 送及び位置決めをするための位置決め孔10が所定の間 隔で形成されている。

【0034】このようなリードフレーム1は、例えば4 2アロイ或いはCu (銅) 等からなる薄板状の基板をエ ッチング或いは打ち抜き加工することにより、所望の形 状に構成している。

【0035】次に前述したように構成されたリードフレ ームを用いた半導体装置の製造方法の一例について簡単 に説明する。

【0036】まず、図1に示すように前記十字形状のダ イパッド2で、該ダイパッド2の一面に接着テープ5が 設けられたリードフレーム1が準備されている。

【0037】そして半導体装置の製造に用いられる半導 体チップ11は略四角形の板状で一面に所定の回路が形 成されており、前記半導体チップの一面には電極パッド 12が複数個、設けられている。

【0038】図2はダイボンディング工程を示す概略構

成図であり、前記半導体チップ11は図2に示すよう に、予め準備された略十字形状に構成されたダイパッド 2と、前記ダイパッド2を支持する支持リード4と、前 記ダイパッド2に搭載される半導体チップと電気的に接 続される複数のリード6と、前記ダイパッド2の搭載面 に半導体チップを固定する絶縁性の接着テープ5とから なるリードフレーム1の所定部位へ搭載される。この 時、前記半導体チップ11は例えば前記リードフレーム 1の前記略十字状に形成されたダイパッド2の搭載面 のリード幅より幅広に形成されており、前記半導体チッ 10 に、前記半導体チップ11の他面、つまりは回路形成面 とは反対の面を、前記ダイパッド2が略対角線上に配置 されるように位置決めされ、前記ダイパッド2の搭載面 に設けられた接着テープ5により接着固定される。その ため、半導体チップをその他面の略対角線上に沿って、 前記支持リード4より幅広に形成された略十字形状のダ イパッド2に接着固定するように構成することにより、 前記半導体チップ11をダイパッド2に容易にかつ良好 に接着固定することができる。尚、本実施形態のように ダイパッド2を略十字形状に構成したリードフレーム1 20 では、半導体チップ11の対角線上に沿って半導体チッ プ11を固定するため、図3に示すように大きさの異な る半導体チップも良好に搭載することができる。このよ うに大きさの異なる半導体チップを一種類のフレームで 共用化することもができ、リードフレームの汎用性を向 上できる。さらに前記リードフレーム1に予め接着テー プ5を設け、前記接着テープ5により半導体チップを固 定しているため接着剤等の液ダレもなく容易に固定でき る。

【0039】そして半導体チップ11を搭載したリード る。前記ダムバー9は前記リードフレーム1に形成され 30 フレーム1は、前記半導体チップ11の一面に殴けられ た電極パッド12と前記リード6のインナー部とが、A u(金)或いはCu(銅)等からなるワイヤ13によっ て結線されることにより電気的に接続される。このワイ ヤボンディング工程では、前記ワイヤ13の先端を溶融 させてボール状に形成した後、該ボールを前記電極パッ ド12に押圧しながら超音波振動を引加し、接合する。 そして、所定のループ形状を描くようにしてワイヤ13 の後端をリード6上に超音波接合する。図4及び図5は ワイヤボンディング工程を示す図であり、図4及び図5 40 に示すように全てのリード6と電極パッド12を結線す ることにより、前記電極パッド12とリードがワイヤ1 3により電気的に接続される。

> 【0040】図6は半導体装置の樹脂封止工程を示す断 面図であり、ワイヤボンディングの完了したリードフレ ーム1は、上下で一対となるモールド金型14によって 型締めされる。そして型締めされたモールド金型14に ゲート15から容融された樹脂、例えばエポキシ樹脂等 の封止樹脂16を、半導体装置のパッケージの外形を型 取るキャビティ17に注入し、前記半導体チップ11、

50 及び電極パッド12とリード6との接続部一帯を封止す

る。前記モールド金型14のキャビティ17への前記封 止樹脂16が充填された後、その状態で数分間保持する と前記封止樹脂16はモールド金型14からの熱により 硬化され、リードフレームにパッケージ18が形成され る。本実施形態では半導体チップ11を搭載するダイバ ッド2が略十字形状で、前記半導体チップ11の他面を その対角線上に沿って固定しているため、前記半導体チ ップの他面と前記ダイパッド2との接着強度を確保する ことができ、樹脂封止の際に注入される樹脂の流動によ チップ11の他面と封止樹脂16との接着面積を大きく できる。

【0041】また図7は前記ダイパッドをダウンセット 加工したリードフレームを用いた場合の樹脂封止工程を 示す断面図である。図7に示すように前記リードフレー ム1のダイパッド2をダウンセット加工、例えば前記ダ イパッド2の半導体チップ搭載面がリード6のインナー 部の他面より下方に位置するようにを加工するように構 成してもよい。このようにダイパッド2をダウンセット 加工することにより、前記モールド金型14へ封止樹脂 20 16を注入する際に前記リードフレーム1を型締めした モールド金型14のキャビティ17の上側の空間と下側 の空間とを略均一にすることができる。さらに前記モー ルド金型14へ注入される封止樹脂16の流動を前記キ ャビティの上下の空間で略均一化することができるた め、前記パッケージ18へのボイドの発生を低減でき、 リードフレームにパッケージ18を良好に形成すること ができる。

【0042】図8及び図9は樹脂封止の完了したリード フレームの構成を示す図であり、リードフレーム1は前 30 記モールド金型14より取り出され、前記リードフレー ム1に半導体チップ11、ダイパッド2、ワイヤ13、 リード6のインナー部を覆うような略四角形のパッケー ジ18が形成される。

【0043】前記パッケージ18の形成されたリードフ レーム1は、切断・成形工程において複数のリード6の アウター部が各々独立するように外枠7、枠体8、及び ダムバー 9 等が切断加工により除去される。前記パッケー ージ18から突出した複数のリード6のアウター部は図 示しない成形金型によりガルウイング形状に成形され る。そして図10及び図11に示されように、略四角形 のパッケージ18の4方向からそれぞれガルウイング形 状に成形された複数本のリードが突出するQFPの半導 体装置19が得られる。

【0044】このように、半導体チップ11を搭載する ダイパッド2が略十字形状で、前記半導体チップの他面 をその対角線上に沿って固定しているため、前記半導体 チップとダイパッドとの接着強度を確保するとともに、 前記半導体チップの他面と封止樹脂との接着面積が大き くすることができ、半導体チップとパッケージの密着性 50 融させてボール状に形成した後、該ボールを前記電極パ

を向上できる半導体装置が得られる。そのため半導体装 置の半導体チップとパッケージの密着性を向上すること により、リフロークラック耐性を向上することができ る。

10

【0045】 (実施形態2) 次に前記実施形態1と同様 に構成されたリードフレーム 1 を用いた他の半導体装置 の製造方法について簡単に説明する。

【0046】前記実施形態1と同様に半導体チップ11 は、予め準備された略十字形状に構成されたダイパッド る半導体チップの剥離を低減できる。さらに前記半導体 10 2と、前記ダイパッド2を支持する支持リード4と、前 記ダイパッド2に搭載される半導体チップと電気的に接 続される複数のリード6と、前記ダイパッド2の一面に 半導体チップを搭載する絶縁性の接着テープ5とからな るリードフレーム1へ搭載される。

> 【0047】本実施形態では前記半導体チップ11が、 例えば前記リードフレーム1の前記略十字状に形成され たダイパッド2の搭載面に、半導体チップ11の一面、 つまりは回路形成された面を、前記ダイパッド2が略対 角線上に配置されるように位置決めし、前記ダイパッド 2の搭載面に設けられた絶縁性の接着テープ5により、 フェイスダウンボンディングで搭載される。この時、前 記十字形状に形成されたダイパッド2は前記半導体チッ プ11の電極パッド12の位置を避けるように接着固定 されている。前記フェイスダウンボンディングによりダ イパッド2に接着固定された半導体チップ11は例えば 図12に示されるように構成される。

【0048】また半導体チップ11をフェイスダウンボ ンディングにより前記ダイパッド2に接着固定している ため、半導体チップ11の電極パッド12の配置、例え ば前記電極パッド12が前記ダイパッドと重なってしま う配置の場合には、図13に示すように前記十字形状の ダイパッド2に切欠部20を形成し、前記電極パッド1 2の位置を避けて、前記半導体チップ11を略対角線上 に沿って、絶縁性の接着テープ5により接着固定するよ うに構成してもよい。このように前記ダイパッドに切欠 部20を形成することにより、ワイヤボンディング工程 での妨げとなることなく電極パッド12が露出され、容 易に半導体チップを搭載することができる。尚、前記ダ イパッド2に前記切欠部20を形成する替わりに、ダイ 40 パッドに図示しない電極パッドが完全に露出するような 開口部を設けるように構成することも可能である。この 切欠部20或いは電極パッド用開口部を設けることによ り、半導体チップと封止樹脂との接着面積をより大きく することができる。

【0049】そして半導体チップ11を搭載したリード フレーム1は、前記半導体チップ11の一面に設けられ た電極パッド12と前記リード6のインナー部とが、ワ イヤ13によって結線されることにより電気的に接続さ れる。本実施形態においては前記ワイヤ13の先端を溶

ッド12に押圧しながら超音波振動を引加し接合する。 そして、所定のループ形状を描くようにしてワイヤ13 の後端をリード6上に超音波接合する。このようなワイ ヤボンディングの際に、図14及び図15に示されるよ うに前記ダイパッド2が半導体チップ11の一面上に配 置されているため、前記半導体チップ11上をダイパッ ドにより確実に保持固定することができる。このように 半導体チップを確実に保持固定できることにより、前記 ワイヤ13を前記電極パッド12に接合する際に、超音 波振動の引加を良好に行うことができ、前記ワイヤ13 10 の接合強度を向上させることができる。

【0050】そして全てのリード6と電極パッド12を 結線され、ワイヤボンディングの完了したリードフレー ム1は、実施形態1と同様に、モールド金型14によっ て型締めされ、ゲート15から溶融された封止樹脂16 を注入することにより、前記半導体チップ11、及び電 極パッド12とリード6との接続部一帯を封止する。前 記半導体チップ11を搭載するダイパッド2が略十字形 状で、前記半導体チップ11の一面をその対角線上に沿 ダイパッドとの接着強度を確保することができ、樹脂封 止の際に注入される樹脂の流動による半導体チップの剥 離を低減できる。尚、本実施形態においても前記リード フレーム1のダイパッド2をダウンセット加工したもの を用いるように構成してもよい。

【0051】そして、樹脂封止の完了したリードフレー ム1は図16に示すように半導体チップ11、ダイパッ ド2、ワイヤ13、リード6のインナー部を覆うような 略四角形のパッケージ18が形成される。

【0052】前記パッケージ18の形成されたリードフ

レーム1は、切断・成形されることにより図17及び図 18に示すようなQFPの半導体装置19が得られる。 【0053】このように半導体チップ11を搭載するダ イパッド2が略十字形状に構成され、前記ダイパッドに 前記半導体チップの一面を、その対角線上に沿って固定 するように搭載しているため、前記半導体チップとダイ パッドとの接着強度を確保するとともに、リフロークラ ック耐性を向上できる半導体装置が得られる。さらに前 記ダイパッド2が半導体チップ11の一面上に配置され ているため、前記ワイヤ13を前記電極パッド12に接 40 合する際に超音波振動の引加を良好に行うことができ、

【0054】以上、本発明者によってなされた発明を実 施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施 形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない 範囲で種々変更可能であることは言うまでもない。例え ば本実施形態ではリードフレームのダイパッドを図1等 に示すような十字形状に構成した場合について説明した が、半導体チップの対角線上に沿って半導体チップを接 着固定できるものであればどのような構成でもよく、例 50

半導体装置の信頼性の向上できる。

えば図19 (a) ~ (c) に示すような形状でもよい。 【0055】また前記ダイパッドを、図20に示すよう に前記リードフレーム1のダイパッド2及び接着テープ 5に、その搭載面から他面に開口する開口部21を設け るように構成することにより、前記ダイパッド2に搭載 される半導体チップ11とパッケージ18との接着面積 をさらに大きくし、密着性を向上させることも可能であ る。

12

[0056]

【発明の効果】本願において開示される発明のうち代表 的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下 記の通りである。

【0057】すなわち、半導体装置のリードフレーム及 びその製造技術において、所定の回路が形成された半導 体チップ11を搭載するダイパッド2が略十字形状に形 成され、かつ前記ダイパッド2の半導体チップ搭載面に 絶縁性の接着テープ5を有しており、前記半導体チップ 11が絶縁性の接着テープ5を介してダイパッド2に搭 載されるように構成したことにより、前記半導体チップ って固定しているため、前記半導体チップの一面と前記 20 11と前記ダイパッド2との接着面積を確保しつつ、前 記半導体チップ11と封止樹脂16との接着面積を大き くすることができ、半導体装置のリフロークラック耐性 を向上することができる。さらに半導体装置のリフロー クラック耐性を向上できるため、半導体装置の信頼性を 向上することができる。

> 【0058】また前記ダイパッドを略十字形状に構成し たことにより、該ダイパッドに異なる大きさの半導体チ ップを搭載可能となり、リードフレームの共用化するこ とができ、フレーム数の削減により製造コストの低減を 30 図ることが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態であるリードフレームの構 成を示す概略平面図である。

【図2】本発明の一実施形態であるリードフレームのダ イパッドへの半導体チップの搭載工程を示す要部平面図

【図3】本発明の一実施形態であるリードフレームへの 異なる大きさの半導体チップの搭載工程を示す要部断面 図である。

【図4】リードフレームのワイヤボンディング工程を示 す平面図である。

【図5】リードフレームのワイヤボンディング工程を示 す図4のA-A '間断面図である。

【図6】リードフレームの樹脂封止工程を示す断面図で ある。

【図7】 ダイパッドがダウンセット加工されたリードフ レームの樹脂封止工程を示す断面図である。

【図8】樹脂封止工程完了後のリードフレームの構成を 示す概略平面図である。

【図9】樹脂封止工程完了後のリードフレームの構成を

示す図8のB-B '間断面図である。

【図10】本発明の一実施形態であるリードフレームを 用いた半導体装置の概略平面図である。

【図11】本発明の一実施形態であるリードフレームを 用いた半導体装置の断面図である。

【図12】本発明のリードフレームを用いた他の半導体 チップ搭載工程を示す要部平面図である。

【図13】本発明のリードフレームを用いた他の半導体 チップ搭載工程の変形例を示す要部平面図である。

ボンディング工程を示す平面図である。

【図15】本発明のリードフレームを用いた他のワイヤ ボンディング工程を示す図14のC-C '間断面図であ

【図16】本発明のリードフレームを用いた他の樹脂封 止工程を示す断面図である。

【図17】本発明のリードフレームを用いた他の半導体 装置の概略構成を示す平面図である。

14

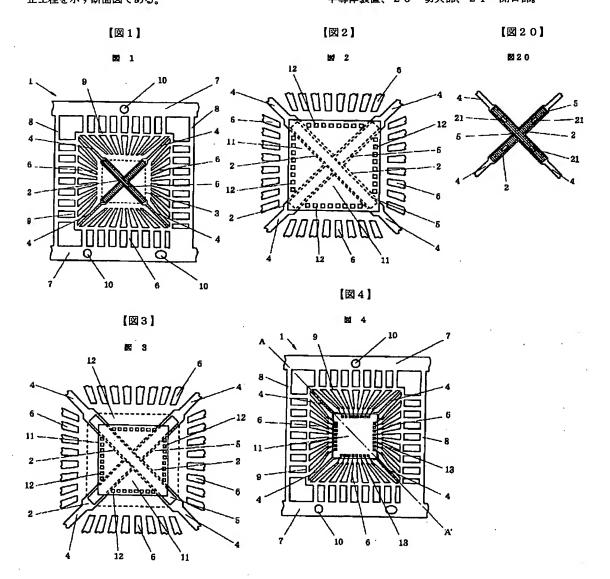
【図18】本発明のリードフレームを用いた他の半導体 装置の断面図である。

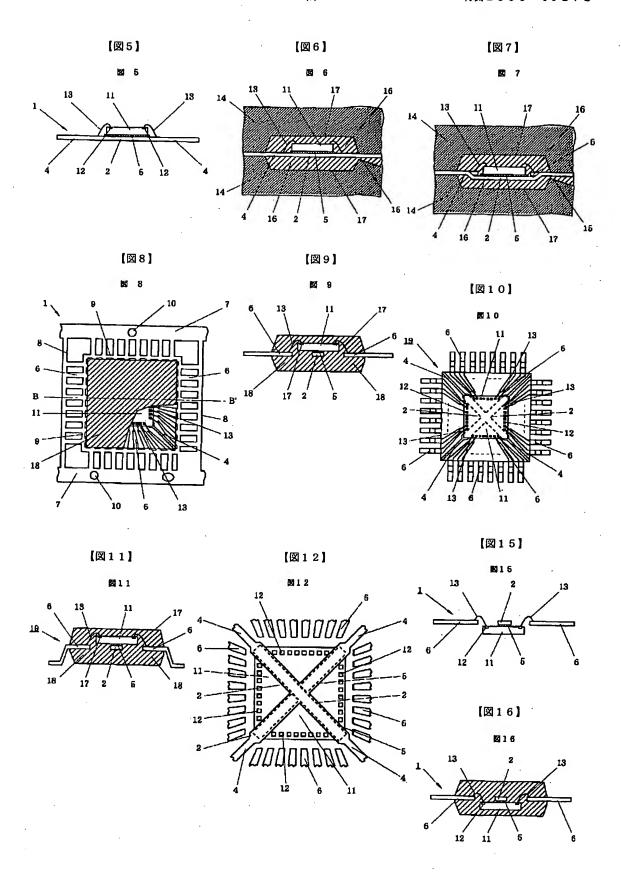
【図19】本発明のリードフレームのダイパッド形状の 変形例を示す概略平面図である。

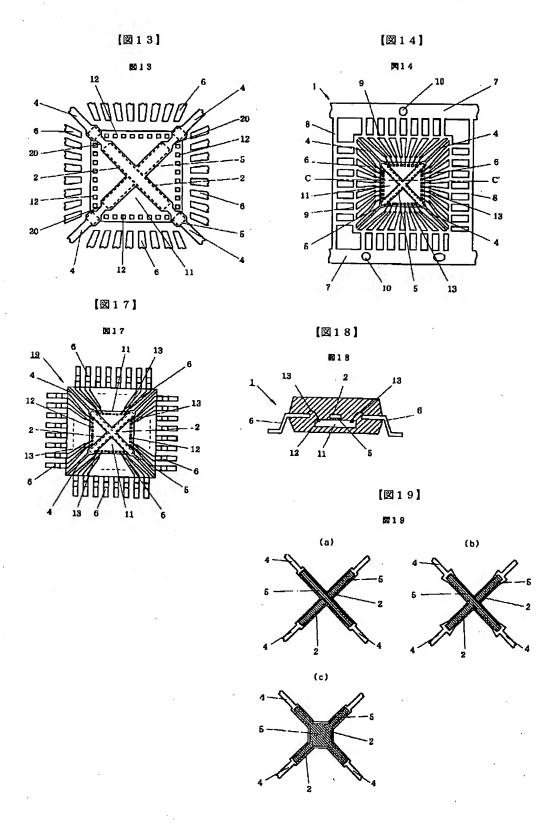
【図20】本発明のリードフレームのダイパッドの変形 例を示す概略平面図である。

【符号の説明】

【図14】本発明のリードフレームを用いた他のワイヤ 10 1…リードフレーム、2…ダイパッド、3…半導体チッ プ搭載部位、4…支持リード、5…接着テープ、6…リ ード、7…外枠、8…枠体、9…ダムバー、10…ガイ ド孔、11…半導体チップ、12…電極パッド、13… ワイヤ、14…モールド金型、15…ゲート、16…封 止樹脂、17…キャピティ、18…パッケージ、19… 半導体装置、20…切欠部、21…開口部。







.

フロントページの続き

(72) 発明者 松井 仁

秋田県南秋田郡天王町天王字長沼64 アキ タ電子株式会社内 Fターム(参考) 5F044 AA01 GG07

5F047 AA11 BA25 BA37 BB03 BC16 5F067 AA04 AA07 AB03 BD05 BD10 BE05 BE09 CC02 CC08 DF16

DF17 EA02 EA04